

NX-2600整片基板带对准可多层次纳米压印加高分辨率光刻系统经过了大量的实时实地验证，质量可靠，性能优越稳定。具备全部压印模式：热固化、紫外固化和压印。基于独特专利保护的Nanonex气垫软压技术（ACP），不论模版或基板背面粗糙程度如何，或是模版或基板表面波浪和弧形结构，NX-2600均可对其校正补偿从而获得无与伦比的压印均匀性，ACP消除了基板与模版之间侧向偏移，有效地延长了模版使用寿命。通过微小热容设计可获得快速的热压印周期，最终得到快速的工艺循环。

主要特点

所有形式的纳米压印

- 热塑化
- 紫外固化
- 热压与紫外压印同时进行
- 热固化

气垫软压技术(ACP)

- Nanonex专利技术
- 完美的整片基板纳米压印均匀性
- 高通量

低于10nm分辨率

亚1微米正面对准精度

背面对准可选项

快速工艺循环时间（小于60秒）

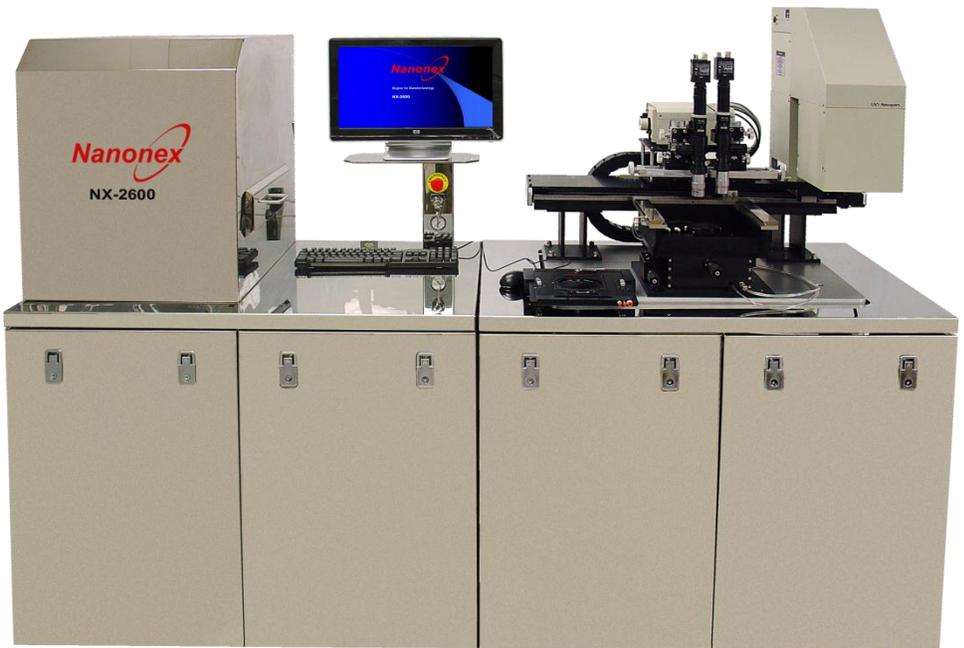
灵活性

- 4", 6", or 8"压印面积可选
- 各种尺寸及不规则形状模版与基板均可压印
- 方便用户操作

基于超过12年、15代产品开发经验的自动化压印操作

Nanonex压印系统经过大量实时实地验证，质量可靠，性能优越稳定

全自动纳米压印



**NX-2600 多功能整片基板带对准功能
多层次的纳米压印和高分辨率光刻系统**

纳米压印系统参数

热塑压印模块

- 温度范围0~250°C
- 加热速度>300°C/分钟
- 制冷速度>150°C/分钟
- 压力范围0 ~ 3.8 MPa (550 psi)

紫外固化模块

- 200W窄带紫外光源
- 365纳米或395纳米波长可选
- 全自动化控制

对准模块

- X, Y, Z, Theta平台
- 分场光学和CCD相机

基板装载

- 标配纳米压印系统可装载4"基板
- 6"和8"基板可选
- 各种尺寸及不规则形状模版及基板均可压印
- 独特专利保护ACP技术可最大限度保护基板和模版，特别对于象磷化铟（InP）等极易碎模版和基板给予最大限度保护。

光刻

- 标配5"模版，标配4"直径基板
- 其他尺寸可以提供
- 500瓦紫外水银灯光源

其他参数

配有微软Windows的电脑控制系统
用户友好的控制软件

程序化控制压印温度、压力和时间

真空和压缩空气操作由电脑控制

手动装载/拆卸基板
全自动化压印操作

设备占地面积：31" × 87"
(787 mm × 2210 mm)

应用领域：纳米电子和光电子、显示器、数据存储介质、先进材料、生物科技、纳米流道等